# ピロリン酸浴からの Cu-Sn 合金の電析

坂本芳一\*,西村孝昭\*\*

# Electrodeposition of Copper-Tin Alloys from the Pyrophosphate Bath

by

# Yoshiichi SAKAMOTO

### (Department of Materials Science and Engineerig)

# Takaaki NISHIMURA

(Tōyō Denka Industry Co., Ltd., Kochi)

Copper-tin electrodeposits are used in protective and decorative finishing of metals. For the commercial electroplating of copper-tin alloys, the stannate-cyanide bath is broadly employed but it is not desirable to use the cyanide baths in respect of pollution controll. The reference to the use of the pyrophosphate bath containing no cyanides is poor except for Rama Char's works. In the present work, studies on the electrodeposition of copper-tin alloys from the pyrophosphate bath containing no cyanides were undertaken with a view to establishing: 1) the effect of concentration of sodium pyrophosphate and ammonium oxalate on the cathodic polarization 2) the effect of plating variables on the composition, current efficiency and the structure of deposits. 3) the relations between tin content in deposits and lattice constant, macro stress and microstrains of electrodeposited  $\alpha$ -Cu alloys.

1 緒 言

耐食性、平滑性の良好なことおよび装飾用の応用な どから有用である青銅メッキの歴史は古く、1862年に Miller<sup>1)</sup> によって初めてシアン浴から青銅メッキが行 なわれた. その後多くの浴2)-6)が開発されたが電析物 の優良性からシアンを含む浴が今日の実用面での主流 を占めている.しかしながら公害問題に関して生体に 有害であるシアンの使用は避けることが望しい. シア ンを全く含まない 青銅メッキ浴 については 1953年に Vaid & Rama Char<sup>5)</sup>によってピロリン酸塩と多量の ピロリン酸ナトリウムを含む浴からの銅―錫合金メッ キの可能性が提案された. しかしこの浴からの電析に ついては学問的に不明な点が多く、また実用的にも広 く到っていない、本研究ではピロリン酸塩浴からの銅 一錫合金の電析機構の解明の一環として両金属の全濃 度比範囲にわたって各種組成の電解浴を調製し所定の 条件下で、先ず陰極分極挙動を検討し、次いで電析物

\* 材料工学科

の組成,電流効率,組織,格子定数,巨視的応力およ び微視的歪に及ぼす電析条件の影響を検討することと した.

#### 2 実験方法

### 2-1 電解浴の調製

本研究に用いた基本ピロリン酸塩電解浴は市販一級 試薬,  $Cu_2P_2O_7 \cdot 5H_2O$ ,  $Sn_2P_2O_7$ ,  $Na_4P_2O_7 \cdot 10H_2O$ ,  $(NH_4)_2 C_2O_4 \cdot H_2O$  を用い, Cu+Sn=0.4mol/1,  $P_2O_7^{4-}(Na)=0.8$ mol/1,  $(P_2O_7^{4-}(Na)/(Cu+Sn)=2.0)$ ,  $(NH_4)_2C_2O_4 \cdot H_2O=20g/1$ , pH=9.0 (NaOH で調製) になるように温度60℃で 調製した. それらの電解浴組成を Table 1 に示す. この基本浴は Rama Char<sup>10</sup> が提案した浴組成 (Sn:23.6g/1, Cu: 9.5g/1,  $P_2O_7(Na): 167g/1$ ,  $(NH_4)_2$  $C_2O_4 \cdot H_2O: 20g/1$ , pH=9.0, 温度: 60°C) を参考 にしたが, pH の調整試薬に関して記載を欠くために 別に  $NH_4OH$ 水で調整した9 種類の電解浴について も陰極分極挙動の差異を検討した.

<sup>\*\*</sup> 東洋電化工業(株)高知

Table 1 Bath composition for electrodeposition of Cu-Sn alloys from pyrophosphate solution

BATH NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cu (mol/L)	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	
Sn (moi/L)	- <u>-</u> -	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0. 30	0.35	0.40
P207(Na)		0-8 mol/L							
(NH4)2C204H20	20 g/L								

#### 2-2 陰極電位-電流密度曲線の測定

陰極電位-電流密度曲線の測定は定電位電解装置 (北斗電工(製)HA-101型)と電位自動加減装置 (北斗電工(製)HB-101型)とを併用して陰極電 位を 480 sec/V の電位走査速度で分極せしめ,その 際の陰極電位と電流密度とを $X-Y \nu = - \delta - 1$ に記 録させた.その測定装置の結線図をFig.1に示す.浴 温度は60℃,測定に用いた電解浴量は 0.6 l とした. なお電解浴の攪拌はマグミキサーで行なった.陰極は 10mm角の白金板であり,片面はエポキシ樹脂で絶縁 してある.陽極は10mm角の白金板である.陰陽両極 間距離は 5 cmとした.



Fig. 1 Block diagram of the apparatus for measurement of cathode potential vs. current density curve

#### 2-3 電 解

電解は電解回路に直列に銅電量計を入れ, 陰極電流 密度 30, 50 および 70mA/cm<sup>2</sup>, 浴温 60℃ で所定の 陰極板に一定電気量だけ電解し, 電析物の組成の分析 用および電折物の組織の同定用の試料を得た. 用いた 浴量は 10 とし, 陰陽両極間距離は 5 cmとした. 陰極 は電析物の組成の分析用には 0.6×20×30mm の白金 板を用い, 電析物の組織の同定, 格子定数, 巨視的応 力および微視的歪の測定には 1.0×20×40mm の冷間 圧延鋼板を用いた. その表面処理はエメリー紙で02ま で研摩後化学研摩して光沢面として実験に供した. 陽 極にはいずれの場合も  $0.6 \times 15 \times 20$ mm の白金板を用いた. 電解浴の攪拌はマグミキサーで行なった.

### 2-4 電析物組成の分析

分析試料は所定の電流密度で電気量 1100 coulomb に統一して電析させて得た. その試料を白金陰極板と 共にビーカーに入れ, 6N- $HNO_3$  約 40ml 加えて加 熱溶解後, 濾別により得た沈殿 ( $H_2SnO_3$ ) を磁性ル ツボに移し乾燥, 強熱して  $SnO_2$  にして秤量し, 電析 物中の Sn 量を算出した. 他方 Cu の分析は濾液を加 熱して HNO<sub>3</sub> を追出した後アンモニア緩衝液 (1N- $NH_4OH$ , 2N- $NH_4Cl$ , 0.05% ゼラチン) で稀釈し た溶液をポーラログラフ法で分析した.

#### 2-5 電流効率の測定

電流効率の測定には銅電量計を用い, Cu および Sn が共に2価から析出すると仮定してそれぞれ求めた. 全電流効率は両者の和とした.

#### 2-6 電析物の組織の同定

電析物の組織の同定用試料は所定の電流密度で電気 量 1400 coulomb に統一して電析させて得た. それら の試料の組織はX線回折によって同定した. X線回折 条件は次の通りである. 対陰極: Cu, フイルター: Ni, 管電圧: 30kV, 管電流: 15mA, スリット巾:  $2^{\circ}-0.15mm-2^{\circ}$ , 走査速度:  $2^{\circ}/min$ ,時定数: 2 sec, 記録紙送り速度: 20mm/min である.

#### 2-7 電析 α-Cu の格子定数の決定

電析  $\alpha$ -Cu の格子定数は組織の同定に用いた同一試 料について X線回折法によって決定した. X線回折条 件は走査速度:  $1/2^{\circ}$ /min,時定数: 8 sec 以外の条件 は 2-6 で示したそれと同一である.計算方法は半価 巾法によって回折ピーク位置を求め, Nelson-Riley 関数<sup>8)</sup> を用いて最小 2 乗法で算出した.

## 2-8 電析 α-Cu の巨視的応力および微視的歪 の測定

電析  $\alpha$ -*Cu* の巨視的応力は {420} 面について *Cu Ka* 線を用いて *Sin*<sup>2</sup>  $\psi$  法で測定した.各角度  $\psi$  の 回折線のピーク位置の決定は定時間計数法と3点放物 線近似法を併用して行ない, *cosec*  $\theta_{\psi}$  *vs*. *Sin*<sup>2</sup>  $\psi$ 線 図から巨視的応力を算出した.ここで $\theta$ o=72.47°, *E*=12500kg/mm<sup>2</sup>,  $\nu$ =0.34なる値を用い,  $\psi$ o は-7°, 15°, 30° および 45° とした.電析  $\alpha$ -*Cu* の徴視的歪 の評価はX線回折線の半価巾が微視的歪のみに依存す ると仮定して各回折線の半価巾の大小によって行なっ た.

### 3-1 Cu-Sn 同時析出の確認

Vaid & Rama Char<sup>5)</sup> が報告したピロリン酸塩浴か らのCu-Sn 同時析出の可能性を確認するためにピロ リン酸銅 単一塩浴の組成として Cu=0.4 mol/l,  $P_2O_7^{4-}(Na)=0.8$ mol/l, ピロリン酸錫単一塩浴の組 成としては Sn=0.4 mol/l,  $P_2O_7^{4-}(Na)=0.8$  mol/l を用い,いずれの浴も pH=9.0 に NaOH で調整し た浴について陰極電位一電流密度曲線を測定した.そ の結果を Fig.2 に示す.両者の陰極電位一電流密度 曲線は約 -0.9V で交叉し, ピロリン酸塩浴からの Cu-Sn 同時析出の可能性が確認された.なおピロリ ン酸錫およびピロリン酸銅単一塩浴のいずれにおいて も分極が増大すると分極曲線に振れあるいはピークが 現われる.これは電解的に生成したある化学種のピロ リン酸塩の付着とその脱離によるものと考えられる.



Fig. 2 Cathode potential vs. current density curves in copper and stannous pyrophosphate bath

# 3-2 陰極電位-電流密度曲線に及ぼすピロリン 酸ナトリウムおよびシウ酸アンモニウムの 添加の影響

陰極分極挙動に及ぼすピロリン酸ナトリウムの添加 の影響を検討するために組成 Sn=0.4mol/l,  $P_2O_7^{4-}$ (Na)=0.4mol/l, pH=9.0 の浴にピロリン酸ナトリ ウムを 0.4mol/l ずつ添加した浴について陰極電位-電流密度曲線を測定した。その結果を Fig. 3 に示す. ピロリン酸ナトリウムの添加によって分極が増大する ことがわかる. 同様のことがピロリン酸銅浴について も観察され, また報告されている<sup>10</sup>). Fig.4 には組成 Cu=0.1 mol/l, Sn=0.3mol/lを含むピロリン酸塩浴 の陰極分極挙動に及ぼすピロリン酸ナトリウムの添加 の影響を示す.混合塩浴において確かに分極が増大す ることがわかった.次に陰極分極挙動に及ぼすシュウ 酸アンモニウムの添加の影響を検討するためにピロリ ン酸錫浴およびピロリン酸銅浴にシュウ酸アンモニウ ムを添加して調べた. Fig.5 は組成 Sn=0.4mol/l,



Fig. 3 Effect of concentration of sodium pyrophosphate on the cathodic polarization curve in stannous pyrophosphate bath



Fig. 4 Effect of concentration of sodium pyrophosphate on the cathodic polarization curve in the mixed bath of copper and stannous pyrophosphate bath

 $P_2O_7^{4^-}(Na) = 0.8 \text{ mol/l}, pH = 9.0 になるように調$ 製したピロリン酸錫浴にシュウ酸アンモニウムを添加した場合の陰極分極曲線の変化を示している.シュウ酸アンモニウムの添加により分極が増大することがわ $かる. Fig.6 には組成 <math>Cu = 0.4 \text{ mol/l}, P_2O_7^{4^-}(Na)$ = 0.8 mol/l,  $pH = 8.0 \sim 9.2 \text{ となるように 調製した$ ピロリン酸銅浴にシュウ酸アンモニウムを添加した場合の陰極分極曲線の変化を示す. ピロリン酸錫浴の場合とは逆にシュウ酸アンモニウムの添加により分極が



Fig. 5 Effect of concentration of ammonium oxalate on the cathodic polarization curve in stannous pyrophosphate bath



Fig. 6 Effect of concentration of ammonium oxalate on the cathodic polarizotion curve in copper pyrophosphate bath

減少することがわかる. それゆえシュウ酸アンモニウ ムの添加はピロリン酸浴中の Cu を復極させ, Sn を 卑に分極させる. その結果 Fig.3 に示した Cu およ び Sn の陰極分極曲線は高電流密度の部分でますます 接近し, 同時折出がさらに増強される. さらに Table 1 に示した 9 種類の基本電解浴の pH 値を  $NH_4OH$ 水で調整した浴について同様に陰極電位一電流密度曲 線を測定した. その結果 Nos. 1~7 の浴では pH値を  $NH_4OH$  水で調整した浴の方が分極が小さく, No.8 および No.9 の浴では逆に NaOH で pH 値 を調整した方が分極が小さいことがわかった. それゆ えアンモニア水の添加はシュウ酸アンモニウムの添加 の効果と同様の挙動を示すことが明らかとなった.

# 3-3 電析物組成と浴組成および電流密度との関係

電析物組成と浴組成および電流密度との関係を Fig. 7 に示す. 電析物中の Sn 含量は何れの電流密度の場 合も浴中の Sn 含量の増加とともに増大する. しかし 浴中の Sn 含量が約 80 mol% までは Cu の析出割 合が非常に大きく,特に浴中の Sn 含量が約 50mol% までは電析物中の Sn 含量は 10 at % 以下である. 電流密度の影響は電流密度の増加とともに電析物中の Sn 含量は増大する傾向がある.



3-4 電流効率と浴組成および電流密度との関係 電流効率と浴組成および電流密度との関係を Fig.8 に示す. Nos.2~4 の浴では低電流密度の電解ほど Cu の電流効率が 100%を大巾に越える. 同時にこれ らの浴では Sn の電流効率が極めて低く10%以下であ



Fig. 8 Ralation between current efficiency and tin concentration in bath

# 3-5 電析物の組織と浴組成および電流密度の関係

電析物の組織と 浴組成 および 電流密度との 関係を Table 2 に示す.表中に RC と記してあるのは Rama Char<sup>6)</sup>の電解浴である.  $\alpha$ -Cu は低電流密度である ほど Sn 含量の高い電解浴からでも析出する.電析物 の組織は浴中の Sn 含量の増大につれて  $\alpha$ -Cu,  $\beta$ ,

Table 2	Relation	between	st	ruc	ture	and	l bath
	composit	ion	R	C :	Ran	na C	Char's
	bath com	position					

			·····							
BATH NO	R C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30 mA/cm <sup>2</sup>	ត"	Cu	¢-Cu	¢-Cu	α-Cu	α-Cu	Յ՝ + ß"	٦	ß-Sn	ß-Sn
50	Ġ"	Cu	d-Cu	α-Cu	¢Cu	ß'	ß"	'n	ß-Sn	ß-Sn
70	ิ เร. กุ	Cu	α-Cu	œCu	ß'	ŋ	η	'n	ദ-ടറ	ß-Sn

β", η, β-Sn の順に析出する. さらに η 相の折出 する浴組成は高電流密度で拡大することがわかる.

Rama Char<sup>7)</sup>の浴は浴中の Cu と Sn の割合が No.6 と No.7 の浴の中間に位置しており, また得 られた電析物の組織も No.6 と No.7 の中間の相を 示す. 電析物の外観はいずれの電流密度で電析した析 出物も組織が  $\alpha$ - $C_u$  および  $\beta'$  相で あるものは 赤色 青銅に近い光沢ないしは半光沢を呈す. スペキュラム 青銅の組成に近いβ", η相は電析後,スポンジ状の被 **膜に被われているが、それを取除くと緻密な銀白色を** 呈している. β-Su は白色の半光沢を呈している. 次 に電析物の組織および組成と Cu-Sn 2元系平衡状態 図<sup>11)</sup> との比較を Fig.9 に示す. 電流密度30mA/cm<sup>2</sup> の場合は Nos.1~5 の浴からは  $\alpha$ -Cu が析出し, No.6 の浴からは  $\beta$  相の 焼入れで 得られる  $\beta' + \beta''$ 相が析出する. No.7の浴からはヵ相が析出し、No. 8 および No.9 浴からは  $\beta$ -Sn が析出している. 電流密度 50 および 70mA/cm2の場合も同様の相が析 出するが高電流密度での電解ほど低い Sn 含量の浴か らでも β", および η 相が析出することがわかる. 特 に電流密度 70mA/cm<sup>2</sup> の場合, Nos. 5~6 の浴から でも 7 相が析出する.

また全ての電析相について興味深いことは平衡状態 図での存在組成範囲が極めて狭い  $\beta$  相および  $\eta$  相が 優先的に電析することである.



Eig. 9 Comparison of structure and equilibrium phase diagram<sup>11)</sup>

# 3-6 電析 α-Cu の格子定数, 巨視的応力および微視的歪と浴組成および電流密度の関係

電析物の格子定数および巨視的応力と浴組成および 電流密度との関係を Fig.10 に示す.何れの電流密度 の場合も Sn 含量の低い浴から析出した  $\alpha$ -Cu の格 子定数は無応力状態の Cu の格子定数  $(a_0)$  よりも小 さく,浴中の Sn 含量の高い浴から電析した  $\alpha$ -Cuの格子定数は浴中の Sn 含量の尚加につれて増大する. 電析  $\alpha$ -Cu の格子定数に及ぼす電流密度の影響は 30 mA/cm<sup>2</sup> で析出した場合の格子定数が他の電流密度で 析出したものより大きいが, 50mA/cm<sup>2</sup> と 70mA/cm<sup>2</sup> との相違は明らかでない. Fig.11 に電析  $\alpha$ -Cu の格 子定数と電折物組成との関係を示す. 電析  $\alpha$ -Cu の 格子定数は Sn 含量の増加とともに増大し, Vegard の法則が成立する. 次に巨視的応力については電析  $\alpha$ -Cu の格子定数が無応力状態の Cu の格子定数  $(a_0)$ 



Fig. 10 Relation between lattice consant, macro stress of clectrodeposited  $\alpha$ -Cu and tin concentration in bath



Eig. 11 Relation between lattice constant of electrodeposited  $\alpha$ -Cu and tin content in deposit

より小さい場合は巨視的応力は引張応力であり、大き い場合は逆に圧縮応力である.したがって巨視的応力 の圧縮方向への増大は格子定数の増大を導くことがわ かる.さらに電析  $\alpha$ -Cu の微視的歪と浴組成および 電流密度の関係を検討するためにX線回折線の拡がり が微視的歪にのみに依存していると仮定して電析  $\alpha$ -Cu の各回折面の半価巾に及ぼす電析物組成および電 流密度の影響を調べた.その結果を Fig.12 に示す. 各回折面の半価巾すなわち微視的歪は電析物の Sn 含 量の高いものほど大きく、また同-Sn 含量の電析物 では低電流密度の場合の方が電析物の微視的歪は大き いことがわかる.



TIN CONTENT IN DEPOSIT ( atomic%)



#### 4 考 察

# 4-1 陰極分極挙動に及ぼす諸添加剤の作用と Rama Char<sup>7)</sup>の電解浴の意味について

3-2の結果から明らかなようにピロリン酸ナトリ ウムの添加の効果は Cuおよび Snの分極を増すこと にあり、 また シュウ酸アンモニウム の添加は浴中の Cuの分極を減じ、逆に Snの分極を増すことにある. アンモニアの添加の効果もシュウ酸アンモニウムのそれと同様の挙動を示す. これらの挙動は浴中のピロリン酸銅および錫が添加剤と錯体を形成することに起因すると考えられる. その錯体の構造は明らかでないが, ピロリン酸銅浴の陰極分極挙動に及ぼすピロリン酸ナトリウムの添加の影響については金野ら<sup>12)</sup>が次の報告をしている. 溶液中の遊離の  $[P_2O_7^{4-}]$ が約 0.12Mよりも少ない場合は次の機構にしたがって銅が電析する.

$ML_2 \leftrightarrows ML + L$	M:	$C_u^2$
--------------------------------	----	---------

 $ML+2e \leftrightarrows Cu+L$ 

,

L:  $P_2 O_7^{4-}$ 

したがってピロリン酸銅浴中のピロリン酸イオン濃度 を増せば浴中の ML2 錯体が増し、その結果電析に寄 与する ML 錯体が減少して浴中の銅イオンの活量が 低下し、分極が増す、このことを拡大して考慮すると ピロリン酸ナトリウムの添加により Cuおよび Snの 分極が増すのは浴中のピロリン酸イオン濃度が増し、 その結果電析反応に不活性な錯体が増すために分極が 増大すると考えられる. 他方シュウ酸アンモニウムの 添加の影響も同様に錯体の形成によると考えられる. ピロリン酸銅浴におけるエタノールアミンの添加の効 果に関する金野12)らの研究によれば、 ピロリン酸銅 浴へのエタノールアミンの添加により浴中に電析に活 性な錯体 MLL'2 (但し M:  $C_u^{2+}$ , L:  $P_2O_7^{4-}$ , L': H2NC2H4OH) が生成し、その結果分極が低下する. 本研究におけるシュウ酸アンモニウムおよびアンモニ アの添加の効果も Cu に関しては同様に説明される. すなわちピロリン酸銅浴中に NH2 基を有する化学 種を添加すると電析反応に活性な錯体が形成すると考 えられ、ピロリン酸錫の場合は逆に不活性な錯体が形 成すると考えられる. 以上の結果から Rama Char<sup>7)</sup> の電解浴の意味を検討する.先ずピロリン酸塩浴から の Cu-Sn 両金属の同時析出は Fig. 2 から考えて十 分に可能である.従って要求されることは有用な電析 物が得られる浴組成を決定することである、この意味 で Rama Char<sup>7)</sup> の電解浴はスペキュラム青銅の電析 を目的としたものであると考えられる. このことは Table 2 から明らかなように  $\beta''$  および  $\eta$  相が析出 していることからも 裏付けられる. 従って Rama Char<sup>7)</sup>の浴組成はスペキュラム青銅の電析を目的と し、かつピロリン酸ナトリウムの添加により分極を増 大させて電着の均一性を期待し、かつシュウ酸アンモ ニウムの添加により Cu および Sn の分極挙動の接近 を期待したものであると考えられる. なお pH=9.0 に設定したことは  $HP_2O_7^{3-}$ の解離定数が  $10^{-8\cdot5}$  で

あることから pH=8.5 付近で大きな緩衝作用を示し, 浴中の両金属を充分に錯化することを期待したもので あろう.浴温度を 60℃ にしたことはピロリン酸ナト リウムの溶解度を増大させるためであると考えられる.

# 4-2 電流効率の 100% 超過と電析物の組成について

Nos. 2~4 の浴では電流密度 30 および 50mA/ cm の場合に電流効率が 100% を大巾に越えている. この原因として電量計の誤差が考えられたが電流値と 電解時間とから算出した電着 Cu 量との比較から電量 計の誤差ではないことが明らかとなった.そこで次に 電流効率の算出法の誤りが考えられる.2-5に示し たように電流効率の算出において Cu および Sn が共 に2価から放電析出すると仮定した.このことは電解 浴の調製時に両金属を2価で加えたためにこの仮定を 置いたのであるが,実験結果から考えて浴中の Cu イオンの一部は化学的に2価から1価に還元されている と考えられる.その還元反応として次の2式が予想さ れる.

$$2C_{u}^{2^{+}} + S_{n}^{2^{+}} \rightarrow 2C_{u}^{+} + S_{n}^{4^{+}}$$
(1)  
(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>+2C<sub>u</sub>^{2^{+}} \rightarrow

 $2CO_2 + 2NH_4^+ + 2C_u^+ \tag{2}$ 

ここで(2)式の反応による還元であるとすればNo.1の 浴においても電流効率の超過が観察されるはずである が,実際には観察されない. Fig.8 から明らかなよ うに電流効率の超過は Nos.2~4 の浴において浴中 の Sn 含量の増加と大約比例的に増す.このことから (1)式の反応による還元であると考えられる.同様の還 元作用は Nos.5~8の浴においても多かれ少なかれ 起っていると考えられるが実験結果からは明らかでな い.しかしこの予想の裏付けとして Fig.7 からかな ように Nos.2~5の浴からの電析物中の Sn at% は 電解浴組成に比べて著しく低い値となっている.この ことは2価の Sn が4価に酸化された結果,電析に際 して2倍量の電気量を要するための低下であると考え られ,全電流効率が Nos.5~6 の電解浴で低下す る原因の一つでもあると考えられる.

# 4-3 電析物の組織および組成と平衡状態図の関 係について

電析物は  $\alpha$ -*Cu* の他に  $\beta'$ ,  $\beta''$  および  $\eta$  相を優 先的に析出している. このうち  $\beta'$ ,  $\beta''$  相は平衡状態 における  $\beta$  相が高温からの 焼入れにより 得られる合 金と類似しており, 温度 60°C の電解浴から析出した 合金が数 100°C からの急冷により得られる合金と類似 していることは興味深い. このことは電子状態に着目

して次のように考察できる.先ず高温からの焼入れに ついて考えると高温では熱エネルギーにより電子は活 性化されてより高エネルギー準位の電子軌道に遷移し ている.原子間の結合は電子の入っている軌道の内の 高エネルギー準位の軌道に属する電子の配置により決 定されるために高温での組織は活性化された電子の入 った状態で安定な結合により形成されている. 急冷に より電子はエネルギーを放出し、より低エネルギー準 位の軌道に落込むが、原子核の移動が遅いために原子 配置は高温の状態に留まり、非平衡な焼入れ組織が生 成すると考える.他方電析の場合は陰極上で表面拡散 移動している段階の金属原子は陰極上に過剰に存在す る電子のために強制的に高エネルギー準位に電子が押 し込まれた状態になっている.従って高エネルギー準 位の軌道の電子状態は高温の場合と同様になっており, この状態で拡散移動して結晶格子形成点に組込まれる ために牛成する組織はこの電子配置に対応するものと なる.従って高温からの急冷と類似な非平衡組織を電 析するものと考えられる.

# 4-4 電析 α-Cu の格子定数, 巨視的応力およ び微視的歪と浴組成, 電流密度および電析 物組成との関係について

電析した  $\alpha$ -Cu の格子定数は何れの 電流密度の場合も Sn 含量の低い浴から析出したものは無応力状態の Cu の格子定数 ( $a_0$ )よりも小さく, Sn 含量の高い浴から 析出した  $\alpha$ -Cu ほど格子定数は 大きい.

Fig. 11 に示したように格子定数は電析物中の Sn 含 量に依存しており、 電析  $\alpha$ -Cu においても Vegard の法則が成立つことが認められる.他方巨視的応力は No.1の浴からの電析 Cu には何れの電流密度の場合 も引張応力が存在し、Nos. 2~5 の浴から析出した α-Cu に存在する巨視的応力は浴中の Sn 含量の増加 とともに圧縮応力方向に変化する. このことから電析 α-Cu の格子定数が電析物中の Sn 含量とともに増大 することは Cu 中に Sn 原子が単に置換型に固溶した ためばかりでなく、巨視的応力の発生と関連している ことがわかる.次に微視的歪も電析物の組成と電流密 度に依存することが Fig.12 よりわかった. このこと も Cu 格子中への Sn 原子の置換型固溶過程に起因し ていると考えられる. Cu 格子に Cu よりも原子半径 の大きい Sn 原子が組込れて結晶格子が歪むためにSn 固溶量の多い電析物では結晶格子が不均一となり、そ の結果X線回折線ピーク位置が不明瞭となって各回析 線が拡がる.

### 5 結 言

本研究はピロリン酸塩浴からの銅-錫合金の電析機 構の解明の一環として両金属の全濃度比範囲にわたっ て各種組成の電解浴を調製して先ず陰極分極挙動を検 討し,次いで電析物の組成,電流効率,組織,格子定数,巨視的応力および微視的歪に及ぼす電析条件の影響を検討した.その結果,次のことが明らかとなった.

(1)ピロリン酸塩浴ではピロリン酸銅単一塩浴の陰極 電位-電流密度曲線とピロリン酸錫一単塩浴のそれと が交叉し,同時析出が明らかである.

(2) ピロリン酸ナトリウムの添加の効果は電解浴中の両金属の分極を増大し、シュウ酸アンモニウムおよびアンモニアの添加の効果は浴中の Cu の分極を減じ、逆に Sn の分極を増大する.その結果、浴中の両金属の析出電位の接近が期待できる.

(3) 電析物の Sn 含量は浴中の Sn 含量 が約 80 mol% までは浴中の Sn 含量に比して著しく低い. その原因として浴中の  $S_n^{2+}$  が  $C_u^{2+}$ を還元して  $S_n^{4+}$ になっていることが考えられる. その結果 Cu の電流効率は Cu が2価として析出すると 仮定して 算出すると 100% を大巾に越える.

(4) 電析物の組織は  $\alpha$ -Cu,  $\beta'$ ,  $\beta''$ ,  $\eta$  および  $\beta$ -Sn の組織に限られ, このうち  $\beta' \geq \beta''$ 相は焼入れ 合金と類似な相である. Rama Char の電解浴からは  $\beta''$ ,  $\eta$ 相の析出が観察される.

(5)電析 α-Cu の格子定数 および 微視的歪は 析出物 中の Sn 含量とともに増大し, 巨視的応力は析出物中 の Sn 含量が少ないうちは引張応力であるが Sn 含量 の増加とともに圧縮応力方向に変化する.

### 参 考 文 献

- 1) M, Miller: U. S. P., 34,640 (1862)
- 2) H. M. Batten et al: U. S. P., 1970,548~
  9 (1934)
- 3) R. M. Angles: J. Electrodepositor's Tech. Soc., 21 19 (1946)
- 4) W. H. Safranek et al: Steel 133 102 (1953)
- J. Vaid and T.L. Rama Char: Current Sci, 22 170 (1953)
- 6) 総説として青谷 薫"合金メッキ"(1966) 槇 書店
- 7) T. L. Rama Char: *Electroplating* and *Metal Finishing* 10 392 (1957)
- J. B. Nelson and D. P. Riley : Proc. Phys. Soc., 57 160 (1945)
- 9)例えば日本材料学会編 "X 線応力測定法"(1966) 養賢堂
- 10) 金野英隆, 永山政一: 第20回防食腐食討論会要旨 (1973)
- M. Hansen : "Constitution of Binary Alloys" (1958) McGraw Hill
- 12)金野英隆,後藤克己,永山政一:第40回電気化学 協会講演要旨集 C116 (1973)